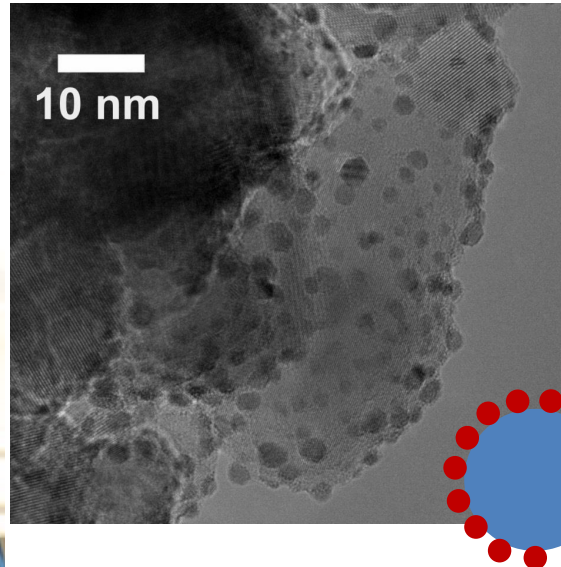
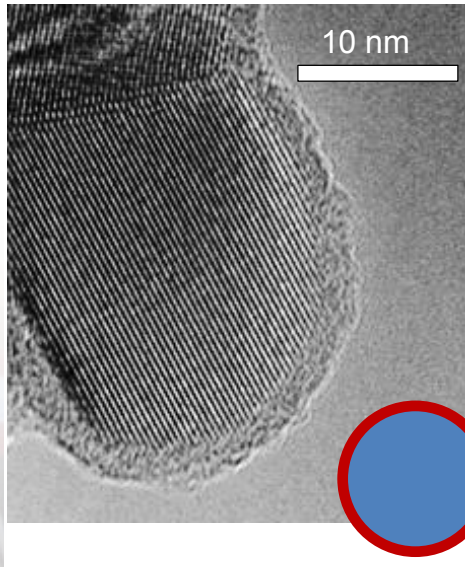
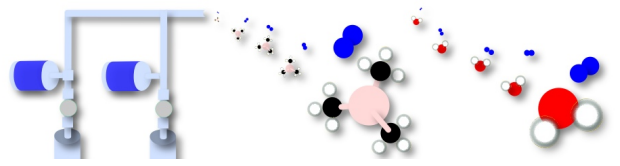


Powder ALD

粉体用ALD装置



製造メーカー: Delft IMP B.V.社(オランダ)

粉体用ALD装置 Model: IMPALA series

半導体技術から生まれた原子層堆積技術(Atomic Layer Deposition = ALD)を粉体向けにナノサイズ厚の成膜を施す技術。ナノパーティクルへの成膜も可能です。

応用範囲: 燃料電池用触媒、リチウムイオン電池用パウダーの保護膜など。

Delft IMP社製

項目	仕様
対象粉体:	対象粉体材料は多岐に渡ります。ご相談ください。
粉体サイズ:	数十nm～数百 μ m
ALD膜種:	レイヤー: Al ₂ O ₃ , TiO ₂ etc、クラスター: Pt, Pd など
ALD膜厚:	1nm～100nm



2方式 ① Fluidized Bed Reactor ② Pneumatic Transport Reactor

輸入総代理店:

ALDジャパン株式会社

〒183-0056 東京都府中市寿町1-3-10-401

Phone: 042-360-3152

E-mail: info@aldjapan.com

